

ディスプレイ・半導体産業、成膜、表面分析のための 超高真空技術

主催 日本真空学会関西支部

【日時・会場】

平成 27 年 8 月 20 日(木) 17:10~18:40 大阪電気通信大学駅前キャンパス

参加のおすすめ

フラットパネルディスプレイ、半導体産業などの分野では、製品の歩留まりを改善するために超高真空技術が不可欠です。また、成膜関連分野でも薄膜の品質を上げるために超高真空仕様装置が必要です。例えば、高純度の窒化膜を作製するためには成膜装置内の水蒸気 (H₂O) の分圧を下げなくてはなりません。また、表面分析関連分野では試料の汚染を防ぐために超高真空が必要です。そこで本スクールコースでは、超高真空装置を製作、改良する上で必要な知識とノウハウを、具体的に丁寧に説明します。フラットパネルディスプレイ、半導体、成膜、表面分析関連分野のメーカーに勤務されている方、装置製作、装置改良の技術をさらに磨きたいと考えておられる方は是非受講ください。

参加要領

参加費(テキスト代、税込み)	非会員、一般 真空学会正会員 真空学会法人会員に所属する個人 学生	3,000 円 2,000 円 2,000 円 0 円
テキスト	講義で使用する PPT ファイルを印刷したもの	
定員	50 名	
申込受付期間	平成 27 年 6 月 1 日(月)~7 月 31 日(金) (当日受付も承ります)	
講師	間瀬一彦 (高エネルギー加速器研究機構)	
問合せ先	深沢博之 (アルバック販売株式会社) hiroyuki_fukasawa@ulvac.com	

講義

テーマ	内容
ディスプレイ・半導体産業、成膜、表面分析のための超高真空技術(1時間30分)	1. 超高真空技術の基礎 2. 超高真空材料 3. 超高真空達成のための真空ポンプと真空計 4. 超高真空装置製作技術 5. 安全、環境保全、省エネルギー

※平成 27 年 8 月 19 日(水)~20 日(木)に開催される【役に立つ真空技術入門講座】終了後に開催。